

Atmospheric CVD apparatus

# 大気開放型 CVD装置



## 真空排気不要の CVD装置

CVD apparatus requires no vacuum apparatus



各種酸化物膜の研究に最適

The most suitable CVD apparatus for various oxide film research.



気化器の増設によりAZOや Y2O3Euなどの作製可能

The multiple vaporizer system makes it possible to prepare various composite films.  
e.g., AZO, Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Eu

>>評価用のテストサンプルの委託成膜も行っております

T.C.S

時田 CVDシステムズ株式会社 <http://www.cvd.co.jp>

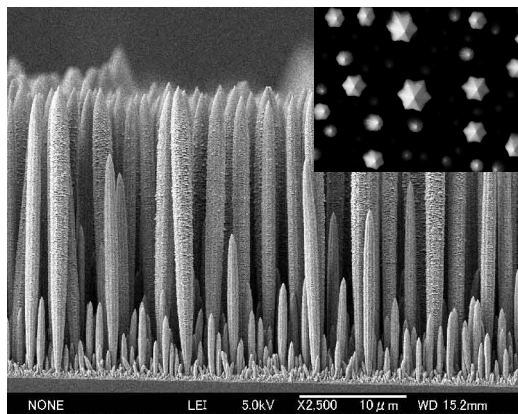
〒 940-2135新潟県長岡市深沢町 2085-16 ながおか新産業創造センター (NBIC内)

TEL : 0258-47-2145 FAX : 0258-47-2146 E-mail : [t.c.s\\_info@cvd.co.jp](mailto:t.c.s_info@cvd.co.jp)

# アプリケーション

## Applications

酸化亜鉛 whisker  
ZnO Whiskers



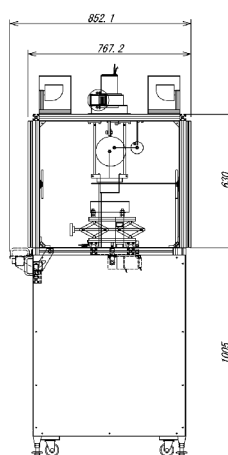
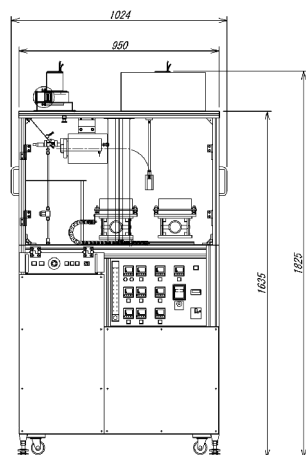
蛍光体薄膜  
Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Eu (red phosphor)



# 装置仕様

## Specifications

ヒーター部 Heating units	基板加熱台 Heating substrate stage	MAX 700
	原料気化器 Vaporizer	MAX 300
成膜温度 Deposition temperature		350~ 650
基板サイズ Substrate size		25x 25mm
膜厚均一性 Film thickness uniformity		± < 10%
外形寸法 System dimensions		W 1024mm× D 738mm× H 1825mm
ユーティリティ Utility	電源 Power supply	単相 200V AC200V (single phase)
	使用ガス Gas	N <sub>2</sub> > 99.9%
	排気管サイズ Exhaust pipe size	100mm



>>実験 開発または、ご購入を検討されているお客さま向けに、テスト機をご用意しています。